

## XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2θ(°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ: |Δ(LogI)|

母集団: 50

個体数: 50

ターゲットχ<sup>2</sup>: 1.00e-004

重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数

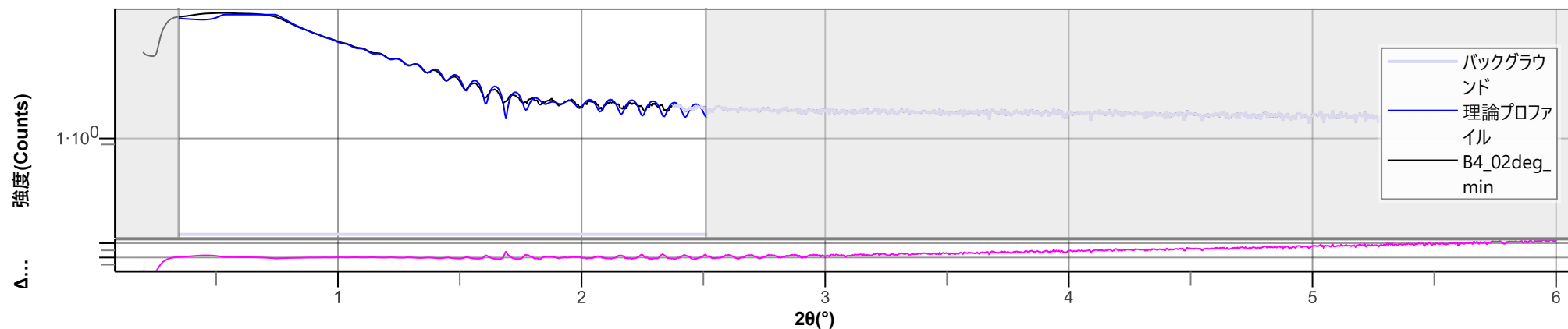
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

## プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm) <th>	密度(g/cm <sup>3</sup> ) <d>	粗さ(nm) <rg>
<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.100 Const	4.94547 Const ±0.03 <b>→最大</b> 精密化	7.159 Con... ±0.13 精密化
<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.869 Const	2.47586 Const ±0.05 <b>最小←</b> 精密化	1.143 Con... ±0.03 精密化
<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	92.384 Const	7.50009 Const	1.499 Con... ±0.018 <b>→最大</b> 精密化
<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...